

聚焦离子束刻蚀机厂家 创世威纳 聚焦离子束刻蚀机

产品名称	聚焦离子束刻蚀机厂家 创世威纳 聚焦离子束刻蚀机
公司名称	北京创世威纳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地高新二街2号4层
联系电话	13146848685

产品详情

刻蚀机

刻蚀精度主要是用保真度、选择比、均匀性等参数来衡量。所谓保真度度，聚焦离子束刻蚀机厂家，就是要求把光刻胶的图形转移到其下的薄膜上，即希望只刻蚀所要刻蚀的薄膜，而对其上的掩膜和其下的衬底没有刻蚀。事实上，以上三个部分都会被刻蚀，只是刻蚀速率不同。选择比就是用来衡量这一指标的参数。 $S=V/U$ （ V 为对薄膜的刻蚀速率， U 为对掩膜或衬底的刻蚀速率）， S 越大则选择比越好。由于跨越整个硅片的薄膜厚度和刻蚀速率不尽相同，从而也导致图形转移的不均匀，等离子刻蚀机尤其是中心和边缘相差较大。因而均匀性成为衡量这一指标的重要参数。除以上参数外，刻蚀速率也是一个重要指标，它用来衡量硅片的产出速度，刻蚀速率越快，则产出率越高。

本产品信息有创世威纳提供，如果您想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！

离子束刻蚀常见的效应

刻蚀的理想结果是将掩模(mask)的图形准确地转移到基片_上，尺寸没有变化。由于物理溅射的存在，掩模本身的不陡直和溅射产额随离子束入射角变化等原因，产生了刻面(Faceting)、槽底开沟(Trenching or Ditching)和再沉积等现象，这些效应的存在降低了图形转移精度。

想要了解更多离子束刻蚀机的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

离子束刻蚀机的原理

创世威纳——专业离子束刻蚀机供应商，聚焦离子束刻蚀机原理，我们为您带来以下信息。

利用辉光放电原理将ya气分解为ya离子，聚焦离子束刻蚀机工作原理，ya离子经过阳极电场的加速对样品表面进行物理轰击，以达到刻蚀的作用。把Ar气充入离子源放电室并使其电离形成等离子体，然后由栅极将离子呈束状引出并加速，具有一定能量的离子束进入工作室，射向固体表面轰击固体表面原子，聚焦离子束刻蚀机，使材料原子发生溅射，达到刻蚀目的，属纯物理刻蚀。

聚焦离子束刻蚀机厂家-创世威纳(在线咨询)-聚焦离子束刻蚀机由北京创世威纳科技有限公司提供。聚焦离子束刻蚀机厂家-创世威纳(在线咨询)-聚焦离子束刻蚀机是北京创世威纳科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。